

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年10月6日 (06.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/093514 A1

(51) 国際特許分類: G03F 7/029, 7/038, C08G 59/68 (74) 代理人: 酒井 宏明 (SAKAI, Hiroaki); 〒1000013 東京都千代田区霞が関三丁目2番6号 東京俱楽部ビルディング 酒井国際特許事務所 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018759 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CI, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GI, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(22) 国際出願日: 2004年12月15日 (15.12.2004) (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特願2004-093624 2004年3月26日 (26.03.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京応化工業株式会社 (TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 Kanagawa (JP).

(72) 発明者: および

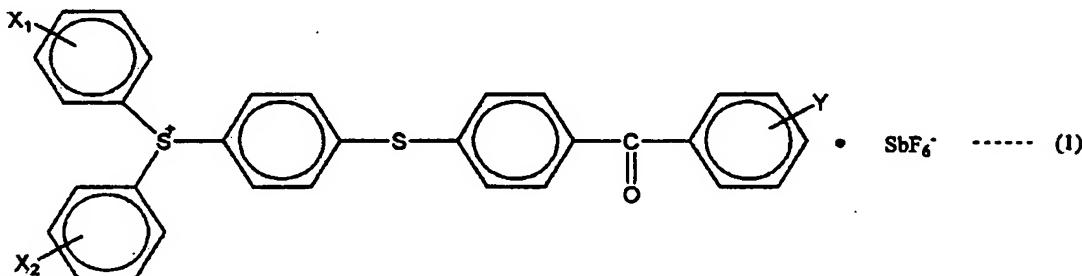
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 前田 浩輝 (MAEDA, Hiroki) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 高橋 亨 (TAKAHASHI, Toru) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 勝又 直也 (KATSUMATA, Naoya) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP).

添付公開書類:
— 國際調査報告書
— 補正書・説明書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドノート」を参照。

(54) Title: PHOTORESISTIVE RESIN COMPOSITION AND METHOD OF FORMING PATTERN WITH THE COMPOSITION

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物および該組成物を用いたパターン形成方法



(57) Abstract: A photosensitive resin composition which comprises a polyfunctional epoxy resin and a cationic polymerization initiator represented by the following general formula (1): [Chemical formula 1] (1) (wherein X₁ and X₂ may be the same or different and each represents hydrogen, halogeno, a hydrocarbon group optionally containing an oxygen or halogen atom, or optionally substituted alkoxy; and Y represents hydrogen, halogeno, a hydrocarbon group optionally containing an oxygen or halogen atom, or optionally substituted alkoxy). This composition is used as a pattern-forming composition.

[競業有]

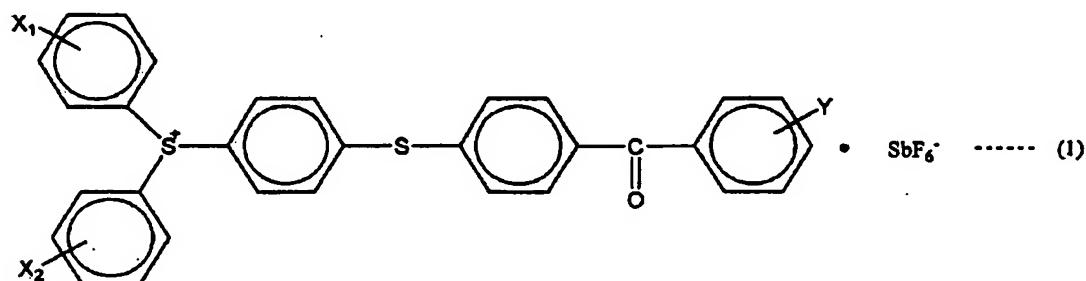
WO 2005/093514 A1



(57) 要約:

多官能エポキシ樹脂と、下記一般式(1)

【化1】



(式中、 X_1 および X_2 は、水素原子、ハロゲン原子、酸素原子またはハロゲン原子を含んでもよい炭化水素基、もしくは置換基が結合してもよいアルコキシ基を表し、互いに同一でも異なってもよく、 Y は、水素原子、ハロゲン原子、酸素原子またはハロゲン原子を含んでもよい炭化水素基、もしくは置換基が結合してもよいアルコキシ基を表す) で表されるカチオン重合開始剤を含有してなる感光性樹脂組成物を、パターン形成組成物として用いる。